# 芯飞睿技术参数十问系列

波前畸变



# 波前畸变

# 一、什么是波前

波前就是波振面,也叫等相面,是指光波振动相位相同的点所构成的面。最初人们将波场中跑在最前面的波面称为波前。在现代光学中,波前指的是直接与接收平面打交道的光场。



图1. 波前

# 二、什么是波前畸变

据马吕斯定律:出射波面与入射波面的对应点之间的光程相等,但是由于存在像差,出射波面的等光程面相对于理想波面发生偏离,这两者的偏移量即为光程差。波前畸变是指若波前在经过一定的传输介质后与传输前发生了改变,比如不再是球面波或者平面波了,称为波前发生了畸变。

# 三、畸变有哪些类型

(1)透射波前畸变(TWD):透射波前畸变产生的原因就是一束光波经过零件时光程n\*d不相等,n是材料折射率,d是光在零件中走过的路程。是描述入射光透射分量与完全平坦平面波的偏差的规范。

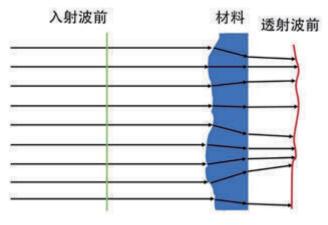


图2. 透射波前畸变

(2) 反射波前畸变(RWD): 反射波前畸变指零件的表面面形有缺陷,引起的一束光波经反射后波前变形。用于描述入射光的反射分量与完全平坦的平面波的偏差。入射平面波在入射侧反射时被扭曲。我们称之为反射波前畸变或RWD。

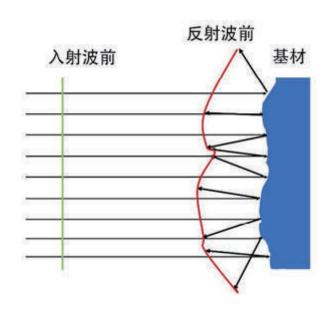


图3. 反射波前畸变

#### 四、是什么导致了波前畸变的产生

导致波前畸变产生的原因有很多,直观的表现就是由面形和平行度以及材料均匀性决定的,拿光学元件的测量举例:

#### (1) 自身因素

#### ①材料质量

晶体在生长的过程中,往往会出现各种各样的缺陷,例如杂质,气泡,晶格缺陷等。会极大的影响材料的光学性能,材料内部的条纹和气泡会造成波前的扭曲。

#### ② 加工

抛光时材料表面的平面度,平行度;

镀膜时薄膜的应力;

元件外框的支撑力。

#### (1) 外部因素

#### ①系统本身

光在经过透镜等光学元件以及经过样品后,由于成像元件的设计和摆放位置不理想,样品折射率不均匀,导致 光偏离理想光路产生波前畸变。

#### ② 环境影响

温度和气流会使局部区域内空气密度不均匀,对测量光束引起局部偏折,改变测量波面,影响测量结果。

环境振动对干涉仪的影响在于它在两相干波面之间引人 了随机的位相变化主要表现为干涉条纹出现抖动现象, 从而造成条纹模糊。



# 五、波前畸变的大小受什么影响

波前畸变由入射表面,出射表面,和介质均匀性综合决定,如果光学材料内部条纹和包络(尤其是晶体内部有断层,位错等情形)比较严重时,面型再好,波前畸变也不能做的很好。

下面以单个基板材料举例:



图4:扁平、平行、均匀的基板入射面:平坦;出射面:平坦;基材:均质

•TWD: 低 •RWD: 低

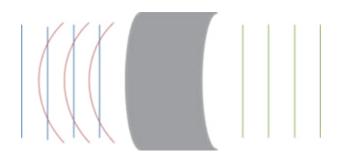


图5: 弯曲、平行、均匀的基板

入射面: 弯曲; 出射面: 弯曲(与A面相同); 基材: 均质

•TWD: 低 •RWD: 高

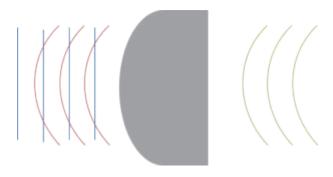


图6: 弯曲、非平行、均匀的基板

入射面: 弯曲; 出射面: 与A面不同; 基材: 均质

•TWD:高 •RWD:高



图7: 扁平、平行、不均匀的基板入射面: 平坦; 出射面: 平坦; 基材: 不均质

•TWD:高 •RWD:低

# 六、为什么要测量透射波前畸变

因为透射波前畸变TWD反映了材料的光学均匀性。

关于光学均匀性与波前畸变的关系,可以这样说,如果 光学均匀性很差的晶体,那很难通过加工得到很理想的 波前畸变(pv值)。单纯的看加工后的面型,用标准平板 就可以。

透射波前失真(TWD)或等效透射波前误差(TWE)是描述入射光透射分量与完全平坦平面波的偏差的规范。TWD通常被指定为用于表征表面图的标称波长的"per/λ"值比(通常为633nm)。TWD在成像应用中尤其重要,因为透射光束的失真可能导致探测器的图像失真,或者探测器的光强度变化不是由被测样品引起的,而是本身影响的结果。TWD主要受涂装前裸露基材特性的影响。基板平行度规格在很大程度上定义了TWD,但由于材料特性引起的有效光学折射率的变化,基板材料中的不均匀性也会影响透射波前。同样,涂层均匀性变化的影响也会影响TWD,尽管涂层和基材不均匀性对TWD的影响几乎总是被物理基材规格所淹没。

# 七、为什么要测量反射波前畸变

反射波前畸变(RWD)或等效反射波前误差(RWE)是一种规范,用于描述入射光的反射分量与完全平坦的平面波的偏差。RWD通常被指定为用于表征表面图的标称波长的"per/\\"值比(通常为633nm)。RWD适用于将反射光束用于成像或检测的应用,因为反射波前的方向和失真都很重要。与TWD一样,RWD在涂覆前受裸露基材特性的影响,但与TWD不同,涂层应力的影响通常对RWD做出非常重要的贡献。初级反射表面的平



坦度在很大程度上决定了RWD,因此基板入射表面的平坦度很重要,但是,由于复杂涂层引起的应力,该表面的曲率总是被涂层本身改变。完全平坦的基板表面可以通过过滤器涂层弯曲(凸起),但可以使用等效应力的背面涂层(应力平衡涂层)至少部分地变平。基板材料中的不均匀性在很大程度上是无关紧要的,因为反射光束不会到达基板材料本身,但涂层均匀性的变化会影响RWD。

在正常入射率下,平坦度和RWE仅相差2倍 RWE =  $2 \times \text{PT}$  平面度 平面度 =  $1/2 \times \text{RWE}$  在非正向入射时,平坦度与RWE的关系取决于入射角 $\theta$  RWE =  $[2 \cdot \cos (\theta)] \cdot \text{PT}$  平面度 平面度 = RWE /  $[2 \cdot \cos (\theta)]$ 

# 八、平面度绝对检验

根据探测原理,主要有两种方法:一种是使用波前探测器直接进行探测,主要有夏克-哈特曼波前传感器等;另一种是基于干涉原理的间接探测,即先得到待测波前在某些特征面上的光强分布,通过进一步的处理,逆向求解得到波前分布。

#### (1) 干涉测量法

干涉测量术(Interferometry)是通过由波的叠加(通常为电磁波)引起的干涉现象来获取信息的技术。干涉仪广泛应用于科学研究和工业生产中对微小位移、折射率以及表面平整度的测量。在干涉仪中,从单个光源发出的光会分为两束,经不同光路,最终交汇产生干涉。所产生的干涉图纹能够反映两束光的光程差。依据叠加原理,波汇合的结果具有能够反映波原始状态的性质。干涉测量术正是基于这一点。当两束频率相同的光叠加时,它们产生的条纹取决于它们的相位差:相位相同时会产生增强条纹,相反则会产生减弱条纹。两种情况之间则会产生中间强度的条纹。这些条纹可以用来分析这两束波的相对相位关。

光学测量通常用菲索干涉仪(如图8所示)来完成。一个参考平面放在待检平面之上。两个平面之间有狭小的空隙。参考平面上表面稍稍倾斜(倾斜角在一度之内)避免后表面的干扰。待检平面与参考平面间的空隙使得两个平面可以成一定的倾角。这个倾角可以增添一个可控的相位梯度以形成干涉纹。人们可以以此来控制干涉纹的排布与方向,得到近乎平行的干涉纹序列而非复杂的轮廓线漩涡。不过平面的分离需要照明光准直。

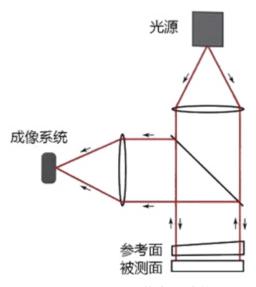


图8. 菲索干涉仪

#### (1) 传感器测量

以Shack-Hartmann传感器(如图9所示)举例,入射光束由一组微透镜聚焦到CCD阵列上。每个镜头元素都有许多CCD像素。在插入样品之前和之后都测量了光斑位置。由样品引起的波前畸变导致斑点移动。利用光斑位置的变化来计算变形波的个数。低成本激光传感器在计量、天文、生命科学等领域有着广泛的应用。

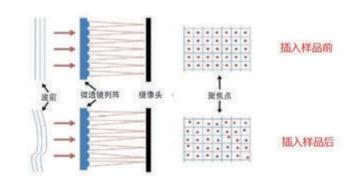


图9. Shack-Hartmann传感器

# 九、平面面形检测的影响因素有什么

#### (1) 光学检测注意事项

- 1. 不可用手触摸光学镜片的表面:
- 2.当镜片表面有脏物时,不要用手直接揩;应先用吹气球吹去灰尘,再用绒布搽,必要时用棉杆沾酒精和乙醚的混合液;
- 3.安装或取下零部件时,应轻拿轻放,以免损伤仪器或产品;
- 4.测量时应耐心、细致,以免产生读数误差;



- 5.对精度要求高的测量,应测三次,取平均值;
- 6.应定期对光学检测设备清洁保养;
- 7.应保持检测实验室干净、整洁、干燥、通风良好;
- (2) 干涉仪的使用注意事项
- 1.仪器应放置在干燥、清洁以及无振动的环境中应用;
- 2.在移动仪器时,为防止导轨变形,应托住底座再进行 移动;
- 3.仪器的光学零件在不用时,应在清洁干燥的器皿中进行存放,以防止发霉;
- 4.尽量不要去擦拭仪器的反光镜、分光镜等,如必须擦拭则应当小心擦拭,利用科学的方法进行清洁;
- 5.导轨、丝杆、螺母与轴孔部分等传动部件,应当保持 良好的润滑。因此必要时要使用精密仪表油润滑;
- 6.在使用时应避免强旋、硬扳等情况,合理恰当的调整 部件;
- 7.避免划伤或腐蚀导轨面丝杆, 保持其不失油;
- 8.应避免在温度变化大、有风、潮湿的环境下使用,否则检测结果将受到很大影响;
- (3) 传感器使用注意事项
- 1.传感器不宜安装在阳光直射处、温度高、可能会结霜 处、有腐蚀性气体处;
- 2.连接导线不要和电力线、动力线使用同一配线管或者 配线槽,或者使用屏蔽线;
- 3.连接导线不能过细,长度不能过长;
- 4.接通电源后要等待一定时间才能进行检测。

# 十、如何选择合适的产品

虽然将所有平坦度、TWD 和 RWD 指定为规范的一部分可能很诱人,但请务必确保未指定功能上不相关的参数,因为这会不必要地增加成本。

以下是有关何时指定 TWD 和/或 RWD 的一些准则:

- •在正常(0度)入射角下使用的滤光片:
- •典型应用:成像
- •在这些光学设计中,对于几乎所有情况,仅使用透射波长,所有其他光都可以被认为是"阻挡"的(而不是反射,即使这是实现阻挡的方式)
- ·不应指定RWD(反射光未恢复)
- •如果保留透射光的波前或方向对应用很重要,则应指定TWD
- •在非正常(通常为 45 度, 但任何值>0)入射角下使用的滤镜:
- •典型应用:多波长成像、光束控制

- •在这些光学设计中,通常同时使用透射波长和反射波长(或者在镜子的情况下仅使用反射波长)
- ·如果要恢复/使用反射光,则应指定RWD
- •在分束器的情况下,如果保留波前或透射光的方向对应用很重要,则应指定TWD

#### 参考文献

[1]https://www.omegafilters.com/sites/default/files/202106/-

Wavefront%20Tech%20Note%20Final.pdf

[2]https://www.iridian.ca/learning\_cen-

ter/how-to-specify-sur-

face-figure-and-wavefront-distortion-for-multi-lay er-optical-filters-dup/

[3]https://mall.pantsiao.com/entry/6

[4]https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B2%E6 %B6%89%E6%B5%8B%E9%87%8F%E6%9C%AF/168 43349

[5]王平,田伟,王汝冬,王立朋。支撑应力对光刻透镜透射波前畸变的影响.《中国光学》2013.



有什么问题请联系我们 的技术工程师,在线为 您解答



了解更多资讯,请关 注我们的公众号--上海 芯飞睿科技有限公司